

CMI243®

准确测量含铁基材上电镀金属的电镀和镀锌

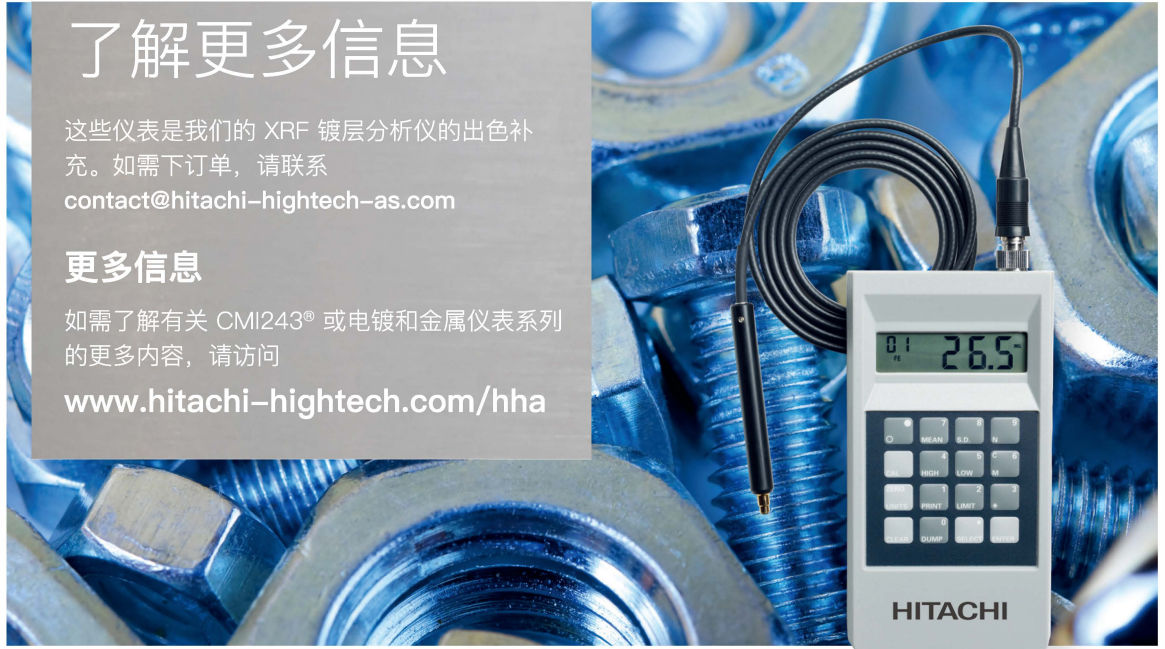
了解更多信息

这些仪表是我们的 XRF 镀层分析仪的出色补充。如需下订单，请联系
contact@hitachi-hightech-as.com

更多信息

如需了解有关 CMI243® 或电镀和金属仪表系列的更多内容，请访问

www.hitachi-hightech.com/hha



高级金属涂层测量

CMI243® 是任何金属表面处理人员的必备工具。该工具具有灵活且易于使用的设计，其带有采用相敏涡电流技术的 ECP-m 探头。

借助使用 ECP-m 探头的 CMI243®，可以精确测量含铁基材上的金属镀层 - 即使在异型或粗糙的小规模表面上也可实现测量。

该仪表适用于紧固件和运输部件，具有与 X 射线荧光 (XRF) 仪器相媲美的用户友好控制和性能。

CMI243® 的附加值体现在，其可以通过磁感应探头进行扩展，以测量磁性基板上的油漆和其他涂层。

关键特色：

- | 采用电池供能。
- | 采用涡电流技术。
- | 可靠且准确。

与XRF技术
结合，提供
卓越精度

相敏涡电流技术

该技术比传统的涡电流和磁感应仪表更加可靠，特别是在分析小部件或几何形状复杂的部件时。准确度在 $\pm 1\%$ 范围内（参考标准），精度在 0.3% 范围内。

高级 ECP-M 探头

我们的 ECP-m 探头专为困难的金属涂层应用而设计。该探头可以测量含铁基材上的金属镀层，如锌、铜、铬或镉。其尖端可轻松测量异型或粗糙的小型部件。

工具包包含：

- | 带导轨的 ECP-m 探头。
- | 锌标准标准。
- | 可选：SMP-1（磁性探头）可单独购买。
- | 准确度： $\pm 1\%$ ，参照参考标准。
- | 精度：0.3%。

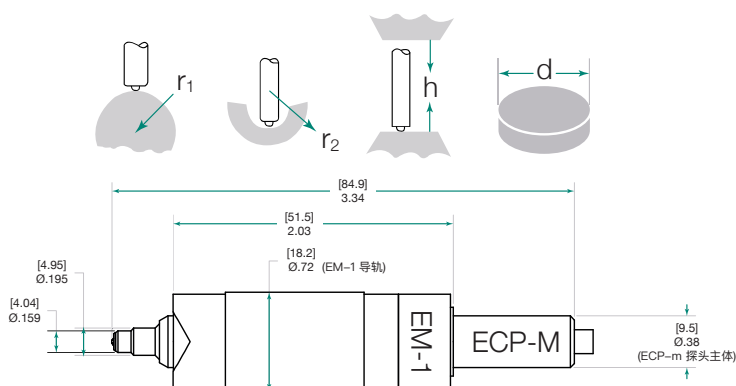
- | 分辨率：0.01 密耳（0.1 微米）。
- | 涡电流：遵从方法 DIN 50984、BS5411 Part 3、ISO 2360、ISO 21968 (DRAFT)、ASTM B499 和 ASTM E376。
- | 存储容量：26,500 个读数。
- | 尺寸（英寸）：5 7/8 英寸（长） \times 3 1/8 英寸（宽） \times 1 3/16 英寸（厚）。
- 厘米：14.9（长） \times 7.94（宽） \times 3.02（厚）。
- | 重量：9 盎司（0.26 千克，含电池）。
- | 单位：使用按键在公制和米制之间自动转换。
- | 显示屏：三台数字 LCD 显示屏，1/2 英寸（1.27 厘米）字符高。
- | 电池：9 V 碱性电池（可供电 65 小时）。



凹凸柱面上的最小半径 (r1) (r2)	工作高度 (高)	最小测量面积 (厚)	最小基底厚度 (密耳)
0.045" (1.143 毫米) 0.135" (3.429 毫米)	4.0" (10.16 厘米)	0.090" (2.286 毫米)	12 (0.3 毫米)

工作范围：

电镀/含铁	厚度范围	探头
Zn	0.1–1.5 密耳 (38 微米)	ECP-m
Cd	0.1–1.5 密耳 (38 微米)	ECP-m
Cr	0.1–1.5 密耳 (38 微米)	ECP-m
Ni	0.1–1.5 密耳 (40 微米)	ECP-m
Cu	0.1–0.40 密耳 (10 微米)	ECP-m
非磁性/含铁	0.1–50 密耳 (1270 微米)	SMP-1



我们的全球服务中心网可以为您提供全面的技术支持。我们在电镀厚度校准和标准方面已获得 A2LA 认证*，这可确保您的 CMI165® 在审核时符合 ISO 17025 规范。

* A2LA 认证适用于由 Hitachi High-Tech Analytical Science America, Inc. 执行的工作。



HITACHI代理商-北京智创翔和科技有限公司 13811350547

Hitachi High-Tech Analytical Science

本出版物的版权归 Hitachi High-Tech Analytical Science 所有。本出版物仅提供概要性信息，除非本公司书面同意，否则不得为任何目的使用、应用或复制这些信息，这些信息也不得构成任何订单或合同的一部分或将其视为与相关产品或服务有关的陈述。Hitachi High-Tech Analytical Science 的政策将不断完善。本公司保留更改任何产品或服务的规格、设计或供应条款的权利，恕不另行通知。

Hitachi High-Tech Analytical Science 承认所有商标和注册。

© Hitachi High-Tech Analytical Science 版权所有，2017 年。保留所有权利。

